

	プラズマ技術研究会	精密加工プロセス研究会	有機エレクトロニクス研究会 (有機薄膜研究会を改名)	画像処理技術研究会	実証技術研究会
開催日・場所	平成21年3月13日(金)13:30~17:30 場所:福岡県中小企業振興センター 5階501号室	平成21年7月22日(水)13:30~17:30 場所:九州大学 伊都キャンパス 914号室	平成21年10月1日(木)10:00~17:00 場所:ARKビル2F 大ホール(福岡市)	平成21年11月16日(月)14:00~17:00 産総研九州センター本館第1会議室	平成21年10月9日(金)14時~17時 場所:ARKビル 2階 第1会議室
講演者(所属)・講演題目	・藤山 寛教授(長崎大学):「新しいプラズマ源が新しいプラズマ応用を拓く」 ・秋山 秀典教授(熊本大学):「バルスパワー及びバルスパワー生成プラズマとその応用」 ・白谷 正治教授(九州大学):「研究開発の効率を飛躍的に高めるコンピュータリアルプラズマ解析装置」 ・上杉 文彦研究員(産総研):「KICC広域連携事業調査—LSIを高精度で安定に量産するための半導体製造装置の開発を目指した部材および構成機器に関する調査研究—について」 ・下沢 慎様(富士電機システムズ株式会社):「フィルム基板アモルファスSi太陽電池とプラズマプロセスを用いた製造技術」	・仙波 卓弥教授(福岡工業大学):「マイクロ複合加工技術とその応用」 ・土肥 俊郎教授(九州大学):「超精密研磨/CMP技術とその応用」 ・星野 高明様(リックス):「マイクロアジャストを使った精密洗浄」 ・河瀬 康弘様(三菱化学):「基板洗浄工程の基本的考え方とその実際—超精密研磨後の有機残渣除去法—」 ・黒河 周平准教授(九州大学):「設備見学」	・服部 勲治教授(九州大学):「有機エレクトロニクスのディスプレイ応用」 ・大武 裕治様(Panasonic):「微細回路形成におけるスクリーン印刷技術」 ・小山 賢秀様(ハリマ化成):「ナノペーストとプリンテッドエレクトロニクス」 ・安井 圭様(日産化学工業):「ハイパーブランチポリマー及び金属ナノ粒子の開発」 ・藤田 克彦准教授(九州大学):「無機ナノ粒子を組み込んだ有機・無機ハイブリッドデバイスの開発」 ・八田 泰三教授(崇城大学):「新しい低分子系有機EL材料」 ・松本 直樹様(東ソー):「有機EL用正孔輸送材料の開発」 ・安達 千波矢教授(九州大学):「新しい有機発光デバイスへの展開—新機構、分子配向、液体半導体—」	・坂井一文様(産総研九州センター):「位相差検出法を用いたワイヤーボンドの3D検査装置」 ・久保 教様(鹿児島工技センター):「多焦点ユニットを用いたICリードの鮮明画像の取得と高さ計測」 ・内野正和様(福岡工技センター):「スペキュル干渉法を利用したICの熱膨張計測」 ・重森 清史様(熊本産技センター):「ICリードフレームのしみ穴検出方法の開発」 ・脇田 仁准教授(九工大):「生産ラインへの画像処理の導入と応用事例」	・石原 政道教授(九工大):「3次元実装の現状」(両面電極パッケージ:DFPを中心として) ・赤沢 隆様(株)ネサステクノロン):「大手半導体企業の実装設計ツールの現状」 ・村田 洋様(株)ジェム・デザイン・テクノロジーズ 代表取締役):「3次元実装設計ツールの現状」
参加者数	44名	46名	90名	36名	40名
開催日・場所	平成21年8月3日(月)13:30~17:30 場所:アルカスSASEBO 3階大会議室C(佐世保市)	平成21年10月30日(金)13:00~17:20 場所:中小企業基盤整備機構九州支部 1階会議室	平成21年12月25日(金)13:00~17:10 場所:福岡県中小企業振興センター 2階 202号室	平成21年12月8日(火)13:30~17:00 場所:鹿児島県工業技術センター大会議室	
講演者(所属)・講演題目	・堀 勝敏教授(名古屋大学):「低温大気圧プラズマの魅力と産業革新」 ・永野 光秀様(日本タングステル):「緻密化したセラミックス材料の諸特性と半導体・電子部品製造への応用」 ・古崎 新一郎様(日本電子材料):「半導体デバイス・ウェハテストにおけるプロービング技術と先端クリーニング技術」 ・山田 浩様(九州電通):「プラズマプロセスを用いた水晶素板薄板化技術とSiダミーウエハの再生技術」	・豊田 紀章准教授(兵庫県立大学):「ガスクラスターイオンビームによる非接触・高精度平坦化加工技術」 ・黒河 周平准教授(九大):「計測評価技術の基礎と応用」 ・小坂 光二様(株)ピーエムティ):「光描画でサブミクロン、早く・安く・高精度—レーザ描画基礎技術の研究開発—」 ・杉浦 健様(福菱セミコンエンジニアリング(株)):「先端分析評価技術の原理と適用事例」 ・野口 稔様(株)日立ハイテクノロジーズ):「半導体ウエハ加工工程での異物検査技術の原理と適用例」	・早瀬 修二教授(九工大):「次世代太陽電池として期待される色素増感太陽電池の研究開発の現状と今後の動向予測」 ・吉田 郷司チーム長(産総研):「有機薄膜太陽電池の最新動向」 ・宮崎 浩(新日鐵化学):「低分子系有機EL材料の開発動向」 ・奥園 博和課長(東レエンジニアリング):「ケミカルエッチングによるポリリミド加工技術の最新動向」	・久保 敦主任研究員(鹿児島県工業技術センター):「多焦点ユニットを用いたICリードの鮮明画像の取得と高さ計測」 ・坂井一文招聘研究員(産総研 生産計測技術研究センター):「位相差検出法を用いたワイヤーボンドの3D検査装置」 ・内野正和専門研究員(福岡県工業技術センター):「スペキュル干渉法を利用したICの熱膨張計測」 ・重森清史研究参事(熊本県産業技術センター):「ICリードフレームのしみ穴検出方法の開発」 ・樋口哲也主任研究員(産総研):「新しいパターン認識技術(HLAC/CHLAC)のご紹介」	
参加者数	33名	33名	57名	37名	
開催日・場所	平成21年11月20日(金)13:30~17:30 場所:KKRホテル熊本 3階 金峰一房の間	平成22年1月29日(金)13:00~17:25 場所:八重洲博多ビル10階 会議室7	平成22年3月10日(水)13:00~17:00 場所:福岡県中小企業振興センター 4階 401号室	平成22年1月21日(木)13:00~16:30 場所:KKRホテル熊本 天皇	
講演者(所属)・講演題目	・寒川 誠二教授(東北大学):「最先端ナノデバイスのための超精密・中性粒子ビームプロセス」 ・白谷 正治教授(九大):「薄膜Si太陽電池のためのプラズマCVD技術のキーポイント」 ・迫田 達也准教授(宮崎大):「大気圧プラズマを用いた太陽電池テラスチャと電極溝の作製」 ・布村 正太様(産総研):「薄膜SiのプラズマCVDプロセスと微細構造制御」 ・竹内 良昭様(三菱重工):「大面積・高効率薄膜シリコン太陽電池の開発」	・大西 修准教授(九大):「超音波振動を援用した加工技術」 ・赤上 隆一 准研究員(秋田県産業技術総合研究センター):「電界低粒・スラリー制御技術が拓く先進基盤加工技術の開発」 ・宮本 誠氏(サムソン横浜研究所):「エレクトロニクス分野の先端洗浄技術」 ・近藤 誠一(Proマネージャー):「超高速・超平坦化を実現する電解研磨技術」 ・宮地 計二事業部長(旭サナック):「精密液体露化技術の半導体デバイス洗浄への応用」	・高嶋 授准教授(九工大):「有機トランジスタの高性能化と大気安定化」 ・八尋 正幸客員准教授(九大):「有機トランジスタ」 ・中村 浩昭主任研究員(出光興産):「有機エレクトロニクス材料の開発動向(分子設計と素子設計)」 ・大野 玲テーマリーダー(三菱化学技術研究センター):「塗布型有機半導体材料」	・重森清史研究参事(熊本県産業技術センター):「ICリードフレームのしみ穴検出方法の開発」 ・内野正和専門研究員(福岡県工業技術センター):「スペキュル干渉法を利用したICの熱膨張計測」 ・久保 敦主任研究員(鹿児島県工業技術センター):「多焦点ユニットを用いたICリードの鮮明画像の取得と高さ計測」 ・坂井一文招聘研究員(産総研 生産計測技術研究センター):「位相差検出法を用いたワイヤーボンドの3D検査装置」 ・奥水大和教授(中京大):「ビジョン技術の産業応用と今後の可能性について」	
参加者数	50名	30名	30名(申込者数)	37名	
開催日・場所	平成22年3月5日(金)13:00~17:00 場所:福岡県中小企業振興センター 3階 301A号室			平成22年2月18日(木)13:00~17:00 場所:福岡県工業技術センター機械電子研究所	
講演者(所属)・講演題目	・斧 高一教授(京大):「プラズマエッチングの現状と課題」 ・庭野 道夫教授(東北大):「多重内部反射赤外分光法によるシリコンウエハの汚染診断」 ・佐藤 康実部長(キャノンアネルバ):「ドライエッチング装置における、ESCウエハステーションの現状と課題」 ・連尾 俊治部長(九州三井アルミニウム工業)			・内野正和専門研究員(福岡県工業技術センター):「スペキュル干渉法を利用したICの熱膨張計測」 ・重森清史研究参事(熊本県産業技術センター):「ICリードフレームのしみ穴検出方法の開発」 ・久保 敦主任研究員(鹿児島県工業技術センター):「多焦点ユニットを用いたICリードの鮮明画像の取得と高さ計測」 ・坂井一文招聘研究員(産総研 生産計測技術研究センター):「位相差検出法を用いたワイヤーボンドの3D検査装置」 ・藤田 元治准教授(和歌山大):「電子部品の高速かつ高精度な二次元・三次元同時形状検査ユニットの開発」	
参加者数	35名			33名	